



## 中华人民共和国国家知识产权局

100037 北京市阜成门外大街 2 号万通新世界广场 8 层 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 何腾云 <i>m062289</i>	发文日
申请号: 2005800045270 	
申请人: 株式会社爱发科	
发明名称: 薄膜形成装置	

## 第一次审查意见通知书

(进入国家阶段的 PCT 申请)

1.  应申请人提出的实审请求,根据专利法第 35 条第 1 款的规定,国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。  
 根据专利法第 35 条第 2 款的规定,国家知识产权局专利局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
2.  申请人要求以其在:

JP 专利局的申请日 2004 年 02 月 10 日为优先权日,  
 专利局的申请日 年 月 日为优先权日,  
 专利局的申请日 年 月 日为优先权日。

3.  申请人于 年 月 日和 年 月 日以及 年 月 日提交了修改文件。  
 经审查,申请人于 年 月 日提交的 不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定。

4.  审查是针对原始提交的国际申请的中文译文进行的。

 审查是针对下述申请文件进行的:

说明书 第 页,按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;  
 第 页,按照专利性国际初步报告附件的中文文本;  
 第 页,按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;  
 第 页,按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;  
 第 页,按照 年 月 日所提交的修改文件。

权利要求 第 项,按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;  
 第 项,按照依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文文本;  
 第 项,按照专利性国际初步报告附件的中文文本;  
 第 项,按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;  
 第 项,按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;  
 第 项,按照 年 月 日所提交的修改文件。

附图 第 页,按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;  
 第 页,按照专利性国际初步报告附件的中文文本;  
 第 页,按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;  
 第 页,按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;  
 第 页,按照 年 月 日所提交的修改文件。



申请号 2005800045270

本通知书引用下述对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期(或抵触申请的申请日)
1	JP4-80734B2	1992-12-21
2	JP2-106036A	1990-04-18
3	JP7-145481A	1995-06-06
4	JP4-14222A	1992-01-20

## 5. 审查的结论性意见:

关于说明书:

- 申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。  
说明书不符合专利法第26条第3款的规定。  
说明书不符合专利法第33条的规定。  
说明书的撰写不符合专利法实施细则第18条的规定。

关于权利要求书:

- 权利要求1-5、11不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。  
权利要求6-10、12不具备专利法第22条第3款规定的创造性。  
权利要求\_\_\_\_\_不具备专利法第22条第4款规定的实用性。  
权利要求\_\_\_\_\_属于专利法第25条规定的不授予专利权的范围。  
权利要求\_\_\_\_\_不符合专利法第26条第4款的规定。  
权利要求\_\_\_\_\_不符合专利法第31条第1款的规定。  
权利要求\_\_\_\_\_不符合专利法第33条的规定。  
权利要求\_\_\_\_\_不符合专利法实施细则第2条第1款的规定。  
权利要求\_\_\_\_\_不符合专利法实施细则第13条第1款的规定。  
权利要求\_\_\_\_\_不符合专利法实施细则第20条的规定。  
权利要求\_\_\_\_\_不符合专利法实施细则第21条的规定。  
权利要求\_\_\_\_\_不符合专利法实施细则第22条的规定。  
权利要求\_\_\_\_\_不符合专利法实施细则第23条的规定。

分案的申请不符合专利法实施细则第43条第1款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

## 6. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。  
申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。  
专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

## 7. 申请人应注意下述事项:

- (1)根据专利法第37条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。  
(2)申请人对其申请的修改应符合专利法第33条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。  
(3)申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交至受理处的文件不具备法律效力。  
(4)未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

## 8. 本通知书正文部分共有 2 页, 并附有下述附件:

引用的对比文件的复印件共 4 份 39 页。

审查员: 陈林(B930)

2008年9月12日

审查部门 材料审查部

21302  
2006.7回函请寄: 100088 北京市海淀区蔚蓝国际大厦6层 国家知识产权局专利局受理处收  
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

## 第一次审查意见通知书正文

申请号：2005800045270

本申请具体涉及一种薄膜形成装置。经审查，现提出如下审查意见。

1、权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。对比文件1(JP4-80734B2)公开了一种真空处理装置，并具体公开了如下特征(实施例及附图1-2)：一种真空处理装置，在处理室1内，其将若干基片保持在可绕旋转轴选择的基板座2的外周面2a上，其必然可以使上述基板座旋转的同时用成膜机构在上述基板上形成薄膜，其包括搬运装置13(即权利要求1中的运入运出装置)，固定机构14，其中搬运装置将基板持有件12(即权利要求1中的基板夹具)相对于基板座2运入或运出处理室1，固定机构14可将基板持有件12固定在基板座2的外周面2a上，也可解除基板持有件12与基板座2的外周面2a间的固定关系，即对比文件1公开了权利要求的全部技术特征，两者属于相同的技术领域，解决的技术问题相同且能产生同样的技术效果，因此权利要求1请求保护的技术方案不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。

2、权利要求2-5均为权利要求1的从属权利要求，其附加技术特征均在对比文件1中已经被公开(参见附图1-2)，在其引用的权利要求1不具备新颖性的情况下，权利要求2-5均不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。

3、权利要求6为权利要求1的从属权利要求，其附加技术特征为“上述固定机构的固定解除，是借助电信号的控制进行的”，通过电信号来控制固定机构是很常规的技术手段，该附加技术特征对于本领域的技术人员来说是很容易想到的，因此在其引用的权利要求1不具备新颖性的情况下，权利要求6不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

3、权利要求7为权利要求1的从属权利要求，其附加技术特征即为其和对比文件1的区别技术特征，而该区别技术特征在对比文件2(JP2-106036A)中被公开(参见说明书第2页左栏第6行-第3页左栏第1行及附图3)：固定结构包括保持结构和解除保持机构，其是通过气缸驱动升降机构4将支持体5(即施力机构)提升，从而向基片2施压使得其固定在基片座3上，通过气缸驱动机构4将支持体5下降，从而解除对基片的固定，其中气缸升降机构4位于可真空排气的容器外侧。其在对比文件2中和在本发明中解决的技术问题一样，都是利用固定机构来实现对基片和基片座之间关系的控制，即对比文件2给出了上述区别技术特征应用到对比文件1以解决技术问题的启示，在对比文件1公开的基础上结合对比文件2得出权利要求7请求保护的技术方案对于本领域的技术人员来说是显而易见的，其不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

4、权利要求8为权利要求1的从属权利要求，其附加技术特征在对比文件3(JP7-145481A)中被公开(参见说明书第[006]、[008]段及附图1、2)：基片固定装置，

其通过磁力来固定住基片，其在对比文件3和本发明中解决的技术问题一样均是通过磁力来控制基片与基片台座的固定状态，即对比文件3给出了上述区别技术特征应用到对比文件1以解决技术问题的启示，在对比文件1公开的基础上结合对比文件3得出权利要求8请求保护的技术方案对于本领域的技术人员来说是显而易见的，其不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

5、权利要求9为权利要求1的从属权利要求，其附加技术特征在对比文件4(JP4-14222A)中被公开(参见实施例1及附图1)：基片处理装置，包括基片运送室6，运送机构7位于运送室6内部，其中运送室6通过阀门与可真空排气的容器9、10等相连，其在对比文件4和本发明中解决的技术问题相同，均是为了保证基片运送时不被外界所污染，即对比文件4给出了上述区别技术特征应用到对比文件1以解决技术问题的启示，在对比文件1公开的基础上结合对比文件4得出权利要求9请求保护的技术方案对于本领域的技术人员来说是显而易见的，其不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

6、权利要求10为权利要求9的从属权利要求，其附加技术特征在对比文件4中也被公开(参见实施例1及附图1)，在其引用的权利要求9不具备创造性的情况下，权利要求10也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

7、权利要求11为权利要求1的从属权利要求，其附加技术特征在对比文件1中被公开(参见权利要求1)：其成膜装置为真空蒸镀装置，在其引用的权利要求1不具备新颖性的情况下，权利要求11也不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。

8、权利要求12为权利要求1的从属权利要求，其对成膜机构做了进一步的限定，该附加技术特征在对比文件4中被公开(参见实施例1及附图1)：成膜机构为干法刻蚀机构或者是溅射机构中的一个或者是其组合，在其引用的权利要求1不具备新颖性的情况下，权利要求12也不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备新颖性或创造性，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有新颖性和创造性的充分理由，本申请将被驳回。

审查员：陈栋

代码：B930

中華人民共和国知的財産局

出願人:	株式会社アルバック	発行日:
弁理士:	何 謙云	2008年09月26日
出願番号:	2005800045270	
発明の名称:	薄膜形成装置	

第1回拒絶理由通知書  
(中国への国内移行のPCT出願)

1.  出願人が提出した審査請求に応じて、中国特許法第35条第1項の規定に基づき、国家知的財産権局が、上記の発明特許出願に対して実体審査を行った。  
 中国特許法第35条第2項の規定に基づき中国知的財産権局は上記の発明特許出願に対して自ら審査を行うことを決定した。
2.  出願人が以下の日付を優先権日と主張した。  
 J P 特許庁での出願日である 2004 年 02 月 10 日を優先権日と主張した。  
 \_\_\_\_\_ 特許庁での出願日である \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日を優先権日と主張した。  
 \_\_\_\_\_ 特許庁での出願日である \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日を優先権日と主張した。
3.  出願人が \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日に提出した補正書類は特許法実施細則第51条を満たさない。
4.  審査は願書に添付された最初に提出した国際出願の中国語訳文に対して行ったものである。  
 審査は下記に添付された出願書類に対して行った：  
 明細書の 第 \_\_\_\_\_ 頁、中国国内移行時に提出した国際出願の中国語訳文；  
 第 \_\_\_\_\_ 頁、国際予備審査報告の付属書類の中国語訳文；  
 第 \_\_\_\_\_ 頁、特許協力条約第28条或は41条に基づき提出した補正書類；  
 第 \_\_\_\_\_ 頁、中国特許法実施細則第51条に基づき提出した補正書類。  
 請求項 第 \_\_\_\_\_ 項、最初に提出した国際出願書類の中国語訳文；  
 第 \_\_\_\_\_ 項、特許協力条約19条に基づき提出した補正文の中文；  
 第 \_\_\_\_\_ 項、国際予備審査報告の付属書類の中国語訳文；  
 第 \_\_\_\_\_ 項、特許協力条約第28条或は41条に基づき提出した補正書；  
 第 \_\_\_\_\_ 項、中国特許法実施細則第51条に基づき提出した補正書類；  
 図面の 第 \_\_\_\_\_ 頁、最初に提出した国際出願書類の中国語訳文；  
 第 \_\_\_\_\_ 頁、国際予備審査報告の付属書類の中国語訳文；  
 第 \_\_\_\_\_ 頁、特許協力条約第28条或は41条に基づき提出した補正書類；  
 第 \_\_\_\_\_ 頁、中国特許法実施細則第51条に基づき提出した補正書類。

- 本意見通知書には、下記の先行技術文献を引用した。(先行技術文献の番号は今後の審査手続きにおいて引き続き使用する。)

1. J P 4-80734B2	1992.12.21
2. J P 2-106036A	1990.04.18
3. J P 7-145481A	1995.06.06
4. J P 4-14222A	1992.01.20

5. 審査の結論的見解

明細書について

- 出願の内容は特許法第5条に規定の特許権を付与できない範囲に属する
- 明細書が特許法第26条第3項の規定を満たさない。
- 明細書が特許法第33条の規定を満たさない。
- 明細書の記述方法が特許法実施細則第18条の規定を満たさない。

請求項について

- 請求項 1-5, 11 は特許法第 22 条第 2 項に規定の新規性を具備しない。
- 請求項 6-10, 12 は特許法第 22 条第 3 項に規定の進歩性を具備しない。
- 請求項 \_\_\_\_\_ は特許法第 22 条第 4 項に規定の実用性を具備しない。
- 請求項 \_\_\_\_\_ は特許法第 25 条に規定される権利を付与できない範囲に属する。
- 請求項 \_\_\_\_\_ は特許法第 26 条第 4 項の規定を満たさない。
- 請求項 \_\_\_\_\_ との間は特許法第 31 条第 1 項の規定を満たさない。
- 請求項 \_\_\_\_\_ は特許法第 33 条の規定を満たさない。
- 請求項 \_\_\_\_\_ は特許実施細則第 2 条第 1 項に規定の発明の定義を満たさない。
- 請求項 \_\_\_\_\_ は特許法実施細則第 13 条第 1 項の規定を満たさない。
- 請求項 \_\_\_\_\_ は特許法実施細則第 20 条の規定を満たさない。
- 請求項 \_\_\_\_\_ は特許法実施細則第 21 条の規定を満たさない。
- 請求項 \_\_\_\_\_ は特許法実施細則第 23 条の規定を満たさない。

上記の結論的見解に関する具体的な分析は本通知書の正文に記載されている。

6. 上記の結論的見解に基づき、審査官が下記の意見を出します：

- 出願人は本通知書正文の要求に応じて出願書類を補正してください。
- 出願人が意見陳述書において上記の特許出願に特許を付与すべき理由について説明し、本通知書正文で指摘された規定を満たしていない個処に対して補正しなければならない、さもなければ、特許を付与することができない。
- この特許出願には、特許を付与されるべき実質的な内容がないので、出願人が理由を陳述しない、あるいは陳述理由が不十分であれば、当該特許出願は拒絶されることになる。

7. 出願人は下記の事項に注意してください：

- (1) 特許法第 37 条の規定に基づき、出願人が本通知書を受領する日から 4 ヶ月 以内に意見を陳述しなければならない。正当な理由がなく期間が経過しても応答しなかった場合には、当該特許出願は取り下げられたものと見なされる。
- (2) 補正する場合は、特許法第 33 条の規定を満たさなければならない、補正書類は一式二部を提出し、補正書類の様式は審査ガイドの規定を満たさなければならない。
- (3) 出願人の意見陳述書及び/又は補正書類は特許局受理部門に郵送或は直接送達しなければならない、受理部門に郵送或は直接送達しなかった書類は法的な効力を具備しない。
- (4) 出願人及び/又は代理人が特許局に来て審査官と面接する場合には予約をしなければならない。

8. 本通知書の正文合計 2 頁、下記の添付書類を含む：

- 引用した先行技術文献のコピー計 4 部 39 頁。

# 第一回拒絶理由通知書正文

出願番号：2005800045270

本出願の発明は薄膜形成装置に関するものである。審査の結果、次の拒絶理由を通知する。

1. 請求項1は特許法第二十二条第二項に規定の新規性を有しない。

既に引例1（JP 4-80734B2）は真空処置装置を開示し、その技術特徴について具体的に次のように開示している。

処理室1内で、回転軸を回転可能な基板ホルダー2の外周面2a上に複数の基板を保持する（そのため、上記基板を回転させながら、成膜手段により各基板上に薄膜を形成することができる）真空処置装置であって、基板・ホルダ組立体12（請求項1に記載の基板固定治具に相当する）を基板ホルダー2に対して処理室に搬入又は処理室から搬出する搬送装置13（請求項1に記載の搬入・搬出手段に相当する）と、基板・ホルダ組立体12を基板ホルダー2の外周面2aに固定解除自在に固定する固定手段14とを備える（引例1の実施例及び図1-2を参照）。

上記から分かるように、請求項1に記載の技術特徴は全て引例1に開示され、二者は同じ技術分野に属し、解決しようとする技術課題も、達成した技術効果も同じである。

従って、請求項1に保護請求の技術方案は特許法第二十二条第二項に規定の新規性を有しない。

2. 請求項2～5は請求項1の従属請求項であり、その付加技術特徴は既に引例1に開示されている（引例1の図1～2を参照）。

従って、引用先の請求項1が新規性を有さない場合、当該従属請求項2～5も特許法第二十二条第二項に規定の新規性を有さない。

3. 請求項6は請求項1の従属請求項であり、その付加技術特徴は「前記固定手段の固定解除が、電気信号による制御によって行われる」ことである。しかし、電気信号によって固定手段を制御するのは本分野の常用手段であり、つまり、上記付加技術特徴は当業者が容易に想到できるものである。

従って、引用先の請求項1が新規性を有さない場合、当該従属請求項6は特許法第二十二条第三項に規定の進歩性を有さない。

4. 請求項7は請求項1の従属請求項であり、その付加技術特徴、即ち、引例1と相違する技術特徴は既に引例2（JP 2-106036A）に開示されている。詳しく言えば、引例2は、固定手段が保持機構と保持解除機構とを有し、前記保持機構は、シリンダー昇降機構4を駆動することによって、支持体5（付勢手段に相当する）を上昇させ、基板2を押えてホルダー3に固定する；前記保持解除機構は、シリンダー昇降機構4によって、支持体5（付勢手段に相当する）を下降させ、前記基板2に対する保持を解除する；前記シリンダー昇降機構4は、真空排気可能な容器の外側に設けられている、と開示している（引例2の明細書第2頁左欄6行目～第3頁左欄1行目及び図3を参照）。

しかも、引例2と本発明との解決しようとする技術課題は同じであり、共に固定手段によって基板と基板ホルダーとの関係を制御することにある。即ち、引例2は、上記相違点の技術特徴を引例1に導入すれば、その技術課題が解決できると示唆している。

引例1を基礎に引例2を組合せて、請求項7に記載の技術方案を得るのは当業者にとって自明である。

従って、請求項7は、目立った実質的な特徴も顕著な効果も有しておらず、特許法第二十二条第三項に規定の進歩性を具备しない。

5. 請求項8は請求項1の従属請求項であり、その付加技術特徴は既に引例3（JP7-145481A）に開示されている。詳しく言えば、引例3は、基板固定手段が、基板を磁力により固定する、と開示している（引例3の明細書「006」、「008」段落及び図1、2を参照）。

しかも、引例3と本発明との解決しようとする技術課題は同じであり、共に磁力によって基板と基板ホルダーとの固定関係を制御することにある。即ち、引例3は、上記相違点を引例1に導入すれば、その技術課題が解決できると示唆している。

引例1を基礎に引例3を組合せて、請求項8に記載の技術方案を得るのは当業者にとって自明である。

従って、請求項8は、目立った実質的な特徴も顕著な効果も有しておらず、特許法第二十二条第三項に規定の進歩性を具備しない。

6. 請求項9は請求項1の従属請求項であり、その付加技術特徴は既に引例4（JP4-14222A）に開示されている。詳しく言えば、引例4は、基板処理装置は、基板搬送室6を有し、搬送機構7が搬送室6内に位置し、搬送室6はバルブを介して真空排気可能な容器9、10等に連続される、と開示している（引例4の明細書実施例1及び図1を参照）。

しかも、引例4と本発明との解決しようとする技術課題は同じであり、共に搬送される基板を外界からの汚染を守ることにある。即ち、引例4は、上記相違点の技術特徴を引例1に導入すれば、その技術課題が解決できると示唆している。

引例1を基礎に引例4を組合せて、請求項9に記載の技術方案を得るのは当業者にとって自明である。

従って、請求項9は、目立った実質的な特徴も顕著な効果も有しておらず、特許法第二十二条第三項に規定の進歩性を具備しない。

7. 請求項10は請求項9の従属請求項であり、その付加技術特徴は既に引例4に開示されている（引例4の明細書実施例1及び図1を参照）。

従って、引用先の請求項9が進歩性を有さない場合、当該従属請求項10も特許法第二十二条第三項に規定の進歩性を有さない。

8. 請求項11は請求項1の従属請求項であり、その付加技術特徴は既に引例1に開示されている。詳しく言えば、引例1は成膜手段は真空蒸着装置である、と開示している。（引例1の請求項1を参照）

従って、引用先の請求項1が新規性を有さない場合、当該従属請求項11も特許法第二十二条第二項に規定の新規性を有さない。

9. 請求項12は請求項1の従属請求項であり、成膜手段について更に限定している。しかし、その付加技術特徴は既に引例4に開示されている。

詳しく言えば、引例4は成膜手段はドライ・エッティング機構又はスパッター装置の何れか又はその組合せである、と開示している（引例4の明細書実施例1及び図1を参照）。

従って、引用先の請求項1が新規性を有さない場合、当該従属請求項12は特許法第二十二条第三項に規定の進歩性を有さない。

上記の理由により、本願の独立請求項並びにその従属請求項は、何れも新規性又は進歩性を有さないため、本願が授権される見込みはない。所定の期限内に、本出願が進歩性を有する十分な理由を提出しなければ、本願は拒絶査定される。